



가종명

APX300 (S옵션)

φ8인치까지의 웨이퍼를 매엽으로 가공

품번: NM-EFE3AA-S

- 풍부한 실적을 쌓은 E620의 프로세스 챔버를 최신 APX300 플랫폼에 탑재하여 같고 닷은 프로세스 라이브러리를 그대로 사용할 수 있습니다.
- 고정도 가공의 멀티 스파이럴 코일 방식 ICP 플라즈마원 “MSC-ICP” 뿐만 아니라 보다 고전자밀도를 실현한 고속 가공용 플라즈마원 “BM-ICP”를 라인업함으로써 폭 넓은 가공 니즈에 대응합니다.
- 대기 반송 유닛으로의 웨이퍼 공급뿐만 아니라 진공 로드 락 공급에도 대응합니다.

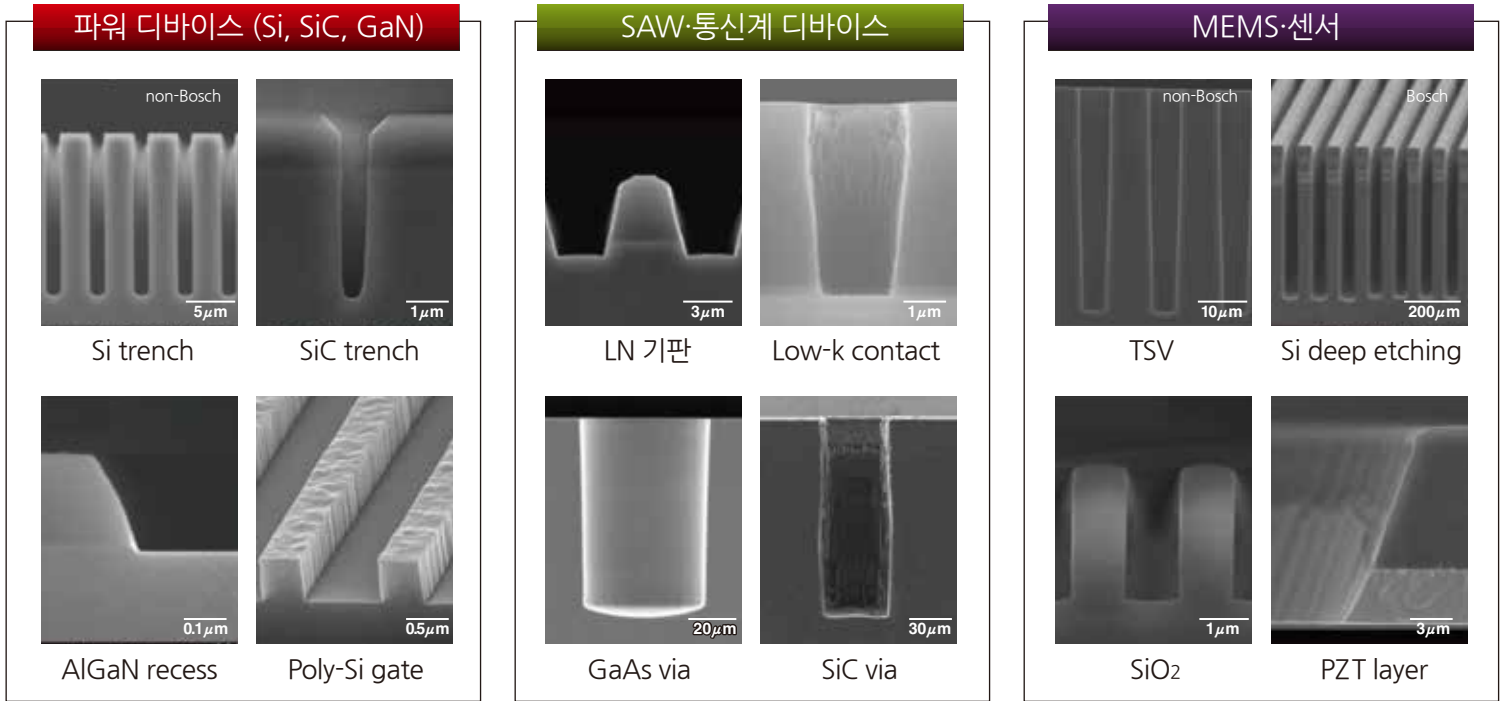
기종명	APX300
품번	NM-EFE3AA-S
플라즈마원	ICP 플라즈마
프로세스 가스	표준 4계통 (최대 6계통까지 증설 가능: 염소계 가스, 불소계 가스, Ar, O ₂ , He 등)
처리대상웨이퍼 ^{※1}	표준 φ100 mm 오리엔테이션 플랫 포함, φ150 mm 오리엔테이션 플랫 포함 및 φ200 mm 노치 포함
설비크기	【로드 락 공급 사양】 W 1,350 mm × D 2,230 mm × H 2,000 mm (터치 패널, 조작부, 시그널 타워 불포함) 【대기 반송 공급 사양】 W 1,375 mm × D 2,600 mm × H 2,000 mm (터치 패널, 조작부, 시그널 타워 불포함)
설비무게	2,000 kg (장치 구성에 따라 상이할 수 있습니다.)
전원 ^{※2}	3상 AC 200 / 208 / 220 / 230 / 240 ±10 V, 50 / 60 Hz, 21.00 kVA
공압원	0.5 MPa ~ 0.7 MPa, 250 L/min (A.N.R.)
N ₂ 원	0.1 MPa ~ 0.2 MPa, 50 L/min (A.N.R.)

※ 자세한 사항은 사양서를 참조해주시기 바랍니다.

※ 1: 다른 사이즈의 웨이퍼는 별도 문의주시기 바랍니다.

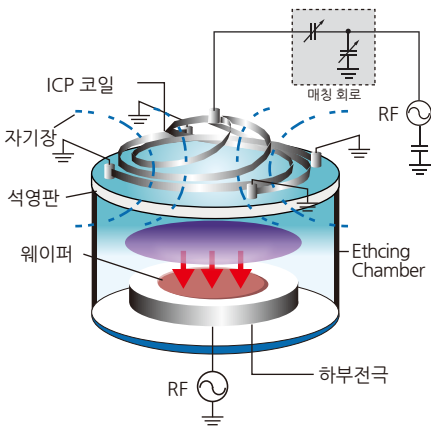
※ 2: 3상 전원은 2계통으로, 그 합계를 나타냅니다.

E620 시리즈의 풍부한 프로세스 라이브러리를 그대로 이용할 수 있습니다.

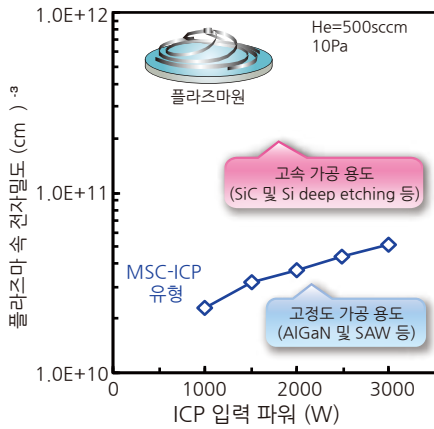


실적있는 Process Chamber와 2종류의 플라즈마원

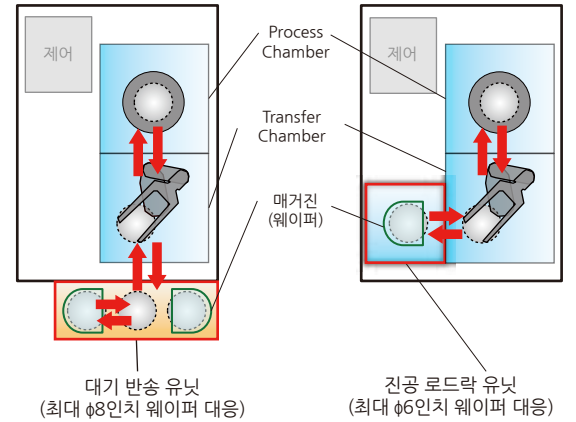
2종류의 웨이퍼 공급 형태



Process Chamber 구조



플라즈마원의 유형과 전자 밀도



대기 반송 공급 사양

진공 반송 공급 사양

⚠ 안전에 관한 주의사항

- 제품을 사용할 때는 취급설명서를 숙지한 후 올바른 방법으로 사용해주시시오.
- 본 카탈로그에 기재된 제품의 안전한 사용을 위해 설비의 가동·정지에 관계없이 설비에 첨부된 취급설명서 및 설비에 부착된 경고 문구를 충분히 확인하신 후, 올바른 조작을 부탁드립니다.

Panasonic은 친환경 제품 만들기에 최선을 다 하고 있습니다

자세한 사항은,
panasonic.com/global/corporate/sustainability

문의 사항 기재란

Panasonic Corporation
 Process Automation Business Division

3-1-1 Inazu-cho, Toyonaka City, Osaka 561-0854, Japan
 TEL +81-6-6866-8675
 FAX +81-6-6862-0422

본 자료의 기재 내용은
 2021년 1월 1일 기준입니다.

Ver.2021.1.1

© Panasonic Corporation 2021